C/SiC复合材料渗 Ni对热物理性能的影响

许 漂 成来飞 张立同 徐永东 童长青 张 青

(西北工业大学超高温结构复合材料国防科技重点实验室,西安 710072)

文 摘采用液相浸渍还原法将 Ni渗入 C/SiC复合材料,用 SBM、XRD技术分析材料的微观结构及组成。采用热膨胀仪和激光脉冲导热仪对材料的热膨胀和热扩散性能进行研究。结果表明:Ni在复合材料内部 呈颗粒聚集体态,CVD SiC涂层过程中,Ni与 SiC基体反应生成 NigSi。渗 Ni后复合材料线胀系数变化趋势在 200~700 内与 C/SiC原料的一致,800 出现肩峰;再经沉积 SiC涂层后线胀系数增大,但整体变化趋势仍与 原料的一致。渗 Ni后材料的热扩散系数明显高于 C/SiC材料。Ni的渗入对 C/SiC复合材料的三点弯曲强度 基本无影响。

关键词 液相浸渍还原,热膨胀,热扩散

Influences of Nickel Infiltration in C/SiC Composite on Its Thermophysical Properties

Xu Piao Cheng Laifei Zhang Litong Xu Yongdong Tong Changqing Zhang Qing (National Key Laboratory of Thermostructure Composite Materials, Northwestern Polytechnical University, Xi 'an 710072)

Abstract C/SiC - Ni is obtained through introduction of metal nickel into C/SiC composite material by liquid infiltration and reduction process. The microstructure and composition of C/SiC - Ni are observed and analyzed by using SEM and XRD technique respectively. In addition, the effects of temperature on coefficient of thermal expansion (CTE) and thermal diffusivity of the composite are also investigated with thermal dilatometer and laser flash apparatus. It is shown that metal nickel exists in the composite in the form of granule agglomerate. Nickel reacts with silicon carbide to form Ni₂S during CVD SiC coating process. After infiltration of nickel, the change trend of CTE is similar to that of C/SiC within the range of 200 - 700, while a peak appears in the curve at 800. The CTE is increased after subsequent deposition of SiC coating, though the overall trend curve remains the same as that of C/SiC. After nickel introduced, the coefficient of thermal diffusivity of the C/SiC composite materials is evidently improved, but mechanical strength is almost not affected

Key words Liquid infiltration and reduction, Thermal expansion, Thermal diffusivity

1 前言

C/SiC复合材料作为航空航天领域常用的高温 结构材料,具有耐高温、高比强度、高比模量,抗氧化 好等^[1]。Ni基合金可以作为焊料实现陶瓷材料之间 以及陶瓷与金属材料的连接^[2],也可用作 C/SiC复 合材料的连接材料。Ni基合金与 C/SiC材料润湿性 良好,在与 C/SiC材料的高温连接过程中,Ni基黏结 剂熔渗进复合材料孔隙中,并发生化学反应,从而得 到较高的连接强度^[3]。因此将 Ni渗入 C/SiC复合材 料,研究 Ni与 C/SiC复合材料的高温反应情况,以及 渗入 Ni对 C/SiC复合材料物理性能的影响都具有重 要意义。

本文以 Ni(NO₃)₂ · 6H₂O为原料,采用液相浸渍 还原的方法将 Ni渗入 C/SiC复合材料,结合 SBM、 XRD技术分析材料的微观形貌及组成,并对 C/SiC 渗 Ni过程中的反应机理及渗 Ni后复合材料的热膨 胀、热扩散性能进行了研究。

2 实验

基金项目:国家自然科学基金 (90505015);国家杰出青年科学基金 (50425208)

作者简介: 许漂, 1981年出生, 硕士研究生, 主要从事 C/SiC复合材料改性研究

宇航材料工艺 2007年 第4期

收稿日期: 2006 - 12 - 19;修回日期: 2007 - 03 - 05

2.1 原料

实验所用二维 C/SiC复合材料以 PAN基二维碳 布叠层为预制体,分别在 800和 1000 采用低压化 学气相渗透(LPCVI)法沉积碳界面层和 SiC基体制 得^[4]。渗 Ni原料采用天津市环海化工厂生产的硝酸 镍(分析纯)。

2.2 C/SIC渗 Ni工艺

将 C/SiC试样在常温下置于真空干燥器中抽真 空 10 min,注入饱和的 Ni(NO₃)₂ · 6H₂O 溶液,真空 下浸渍 30 min后,取出试样于 80 在干燥箱中干燥, 再将试样放入 25 mm ×400 mm 石英管并置于管式 炉中,H₂气氛下升温至 700 并保温 1 h,H₂气氛下冷 却到室温,取出试样并去除试样表面还原物质,重复 浸渍还原的过程数次。将得到的试样在 1 000 下沉 积 SiC涂层,沉积时间为 120 h,即得到 C/SiC渗 Ni 复合材料。制备工艺流程如图 1所示。





2.3 测试与表征

采用 X射线衍射仪 (XRD, Rigaku-D/max-2400, CuK 射线,管电压为 40 kV,管电流为 100 mA)对所 制得材料进行物相分析,扫描速率为 4 %m in,步长为 0.02°扫描角度范围为 20°~80°采用扫描电镜 (含能谱) (SEM, Hitachi - S4700)观察微观形貌。分 别采用热膨胀仪 (NETZSCH - DL 402C)、激光导热 仪 (激光脉冲 LFA - 427)测试线胀系数与热扩散系 数.测试过程中以 Ar为保护气氛,测量温度范围从室 温到 1 000 ,升温速率分别为 3 /min 5 /min。 热膨胀仪测试误差在 400 以内小于 5%,400 以上 小于 2%。热膨胀分析所用试样尺寸为 20 mm ×5 mm x3 mm,热扩散分析试样尺寸为 12.7 mm x2 mm圆柱体。用阿基米德排水法测量材料开孔率。 采用万能实验机 (SANS CMT 4304)测试试样的三点 弯曲强度,试样尺寸为 40 mm ×5 mm ×3 mm,跨距为 20 mm,加载速度为 0.5 mm/min.

3 结果与讨论

3.1 增重率与开孔率变化

图 2为浸渍还原后试样的增重率及开孔率随循 环次数的变化曲线。增重率计算公式为:

$$w = (m_1 - m_0) / m_0 \tag{1}$$

式中, m_1 为渗 Ni后试样质量, m_0 为 C/SiC原料质量。

由图 2可见,随循环次数的增加,试样增重率呈 线性增加趋势,而开孔率逐渐降低。浸渍还原 11次 后,试样增重率增至 25.4%,气孔率由初始值 19.3% 下降为 14.2%。循环次数达 8次后,开气孔率随循 环次数变化缓慢。这是由于浸渍还原后,金属在靠近 试样表面处堆积较多,封填了溶液进入试样内部的孔 隙。因此随浸渍还原次数增多,溶液难以渗入试样内 部而吸附在试样表面上,致使开孔率变化缓慢。



gain and porosity rate

3.2 显微结构

图 3为 Ni质量分数为 25.4%的 C/SiC断面成分 及形貌图,由能谱分析可见复合材料断面的主要元素 成分为 Ni C, Si[图 3(a)],金属盐已完全还原为 Ni 由图 3(b)可见,Ni已填充到 C纤维束之间,但仍有 较大的孔隙未能完全填充,Ni基体内部以及渗入的 Ni与纤维束之间仍有孔隙存在。渗入的 Ni形成 1~ 10 µm的不规则颗粒聚集体 [图 3(c)]。此外,液相 浸渍的方法还能将 Ni渗入纤维束内部 [图 3(d)],且 填充较为致密。这是由于单丝纤维之间的毛细管作 用扩散到纤维束内部,使得纤维束内部致密度较高。由 图 3(d)还可以看出,Ni(NO₃)₂ · 6H₂O溶液的渗入 使少量纤维受到损伤,但是由于渗入的镍盐含量较 少,因此对力学性能影响很小。

宇航材料工艺 2007年 第 4期



(a) EDS分析



(c) 图 (b)中 A区域的放大



(b) SEM分析



(d) 图 (b)中 B区域的放大

图 3 C/SiC渗 Ni后材料断面 SEM及 EDS分析 Fig 3 SEM and EDS images of cross-section of composite

3.3 材料组成及反应机理

图 4为 C/SIC渗 Ni后材料在沉积 SIC前后的衍射 图。可见、沉积 SC前,即浸渍还原后,材料的物质组成为 Ni SC C沉积 SC后物质组成为 Ni Si SC C。





从 Ni(NO₃)₂ · 6H₂O得到 Ni的过程包括 Ni (NO₃)₂ · 6H₂O 分解为 NO₅NO 还原为 Ni两个过 程。一般认为, $Ni(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ 于 65 开始熔融, 95 以上失去部分结晶水。在 450 以上得到最终 宇航材料工艺 2007年 第4期

分解产物 NO^[5],在 700 H₂气氛下还原 1 h后 NO 全部还原为 Ni, 反应方程式为:

$$2Ni(NO_3)_2 = 2NiO + 4NO_2 + O_2$$
 (2)

$$N\dot{D} + H_2 \overline{} N\dot{i} + H_2 O \qquad (3)$$

图 4曲线 中 Ni_bSi的生成说明在沉积 SiC过程 中 Ni可能与原基体 SiC或新沉积的 SiC发生了反应。 为进一步研究 Ni在 CVD SIC过程中的反应情况,将渗 Ni后的试样在等同与 CVD SiC 的温度 (1 000)下高 温处理 10 h,得到的衍射图谱如图 4曲线 所示,其物 质组成与图 3曲线 相同,说明在该温度下,Ni与 SiC 基体反应生成 Ni, Si,反应结束后,试样中的 Ni全部转 化为 Ni Si 其反应为:

$$Ni + SiC \longrightarrow N_{\frac{1}{2}}Si + C \qquad (4)$$

— 75 —

影响该反应的动力学因素有两个:界面处 SiC的 分解以及 Ni与 Si原子通过反应层的扩散^[6~7]。

从热力学角度分析,在 800~1 000 内, SIC的 自由能较高,因此与金属结合时表现为不稳定的化学 特性。另外,镍硅化物的自由能较低,因此生成的硅 化物能稳定存在。表 1为反应 (4)中反应物及产物 在 1 000 下自由能值,计算得到反应 G为 - 69.06 kJ/mol。由 1 170 Ni-Si-C三元相图^[8] (图 5)可 见,Ni,Si,SiC,C三者可稳定存在。S Ngtae Kim^[9]等 人研究表明,900 时,Ni与无定形 SiC反应产物也有

N i Si存在。因此,本实验温度 1 000 下的反应产物 N i Si可以与 SiC, C稳定共存,与实验结果一致。

表 1	反应物及产物 1 000 自由能
Tab 1	Gibbs free energies of reactants
and products at 1 000	

_	
材料	$G/\mathrm{kJ}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$
SiC	- 127. 621
Ni	- 64. 105
N i ₂ Si	- 304. 790
C	- 20, 099



- 图 5 C-Ni-Si系统 1 170 三元相图 Fig 5 Temary phase diagram of C-Ni-Si system at 1 170
- 3.4 热物理性能

3.4.1 热膨胀性能

C/SiC 原 料、C/SiC 渗 Ni (Ni 质量分数为 25.4%)材料以及渗 Ni并沉积 SiC涂层后复合材料 线胀系数随温度的变化曲线如图 6所示。由曲线 可见,在测量温度范围内,C/SiC原料线胀系数随温 度的升高呈逐渐升高趋势。C/SiC渗 Ni材料(曲线

)在 200~700 内热膨胀变化趋势与原料曲线一 致,在 700~800 内线胀系数迅速增大,随后逐渐下 降,接近原料曲线。沉积 SiC涂层后,材料的线胀系 数随温度的变化规律(曲线)与原料相同,但线胀 系数值有所增大。





复合材料的线胀系数可以表示为:

$$=\frac{\sum_{i}E_{i}V_{i}}{\sum E_{i}V_{i}}$$
(5)

式中,,,为材料内质点,;的线胀系数,E,为材料内,;相 的弹性模量, V, 为材料内 i相的体积分数。渗 Ni后材 料由 Ni, SiC基体、C纤维组成。在 200~1000 内,Ni 的线胀系数为(15.57~17.46)×10⁻⁶/K.远高于 C/ SIC原料。由于线胀系数的差异,从制备温度冷却到 室温时.在 Ni与 C/SiC材料界面处会产生热应力。 随着温度的升高,Ni与 C/SiC材料同时膨胀,但由于 Ni位于复合材料孔隙中,含量较少且结构不致密,材 料内部的微裂纹及孔隙为复合材料的膨胀提供了空 间,因此渗 Ni后材料的热膨胀与原料 C/SiC相差不 大。制备温度(700)以后,界面热应力消除,Ni的 热膨胀占主导因素, 随温度升高增加速率较快, 800 以后,Ni的膨胀受 C/SiC材料抑制,线胀系数下降至 接近 C/SiC原料曲线。另外,高温下(800~1000) 虽有 Ni, Si产物生成, 且 Ni, Si在 870~1 070 下线 胀系数为 19 ×10⁻⁶/K,但由于含量较少,因此对材料 的线胀系数影响不大。沉积 SIC涂层后 (曲线), 由于低温测试误差的影响,线胀系数变化规律在整个 温度范围内与原料曲线 一致,但数值略高于原料曲 线。这是由于沉积 SiC使材料致密度提高,而 Ni 相对含量较少,且 SiC线胀系数高于 C/SiC渗 Ni材 料所致,同时使曲线 中 800 处的峰消失。

3.4.2 热扩散性能

图 7为 C/SiC原料、C/SiC渗 Ni(Ni质量分数为 25.4%)并热处理 (1 000 /10 h)后、渗 Ni并沉积 SiC涂层后复合材料的热扩散系数随温度的变化曲 线,分别以 、、表示。



图 7 C/SiC渗 N i后材料热扩散系数随温度变化曲线 Fig 7 Thermal diffusivity vs temperature of C/SiC after N i infiltration

为了更好地研究渗 N i对 C/SiC复合材料热扩散 性能的影响,同时测试 C/SiC原料沉积 SiC涂层后材 料的热扩散系数(曲线)。 ~ 四种试样的开孔 宇航材料工艺 2007年 第4期

- 76 -

率分别为 18.7%、13.0%、14.3%、12.7%。由图可 见、四种材料的热扩散系数从小到大依次为 、、

、。可以看出,C/SiC材料渗 Ni可明显提高材料的热扩散性能。

C/SiC材料渗 Ni并热处理后,在原纤维编织孔 隙处生成的 Nig Si使得材料热扩散率高于 C/SiC原 料。金属间化合物 Nig Si中存在电子导热,而 C/SiC 复合材料热传导则是通过声子的相互作用实现^[10], 电子的导热能力优于声子。因此,Nig Si的热扩散性 能优于 C/SiC复合材料,这是渗 Ni后材料热扩散性 能提高的主要原因。另外,渗 Ni后材料的致密度较 C/SiC材料高,晶粒间联通状态较好,晶格缺陷少,对 声子及电子的散射降低,也使得热扩散系数升高。沉 积 SiC涂层后材料致密度进一步提高,使热传导路径 更为连贯,热扩散率上升,而材料中 Nig Si的存在使 热扩散率远高于 C/SiC沉积涂层后的材料。因此 C/ SiC渗 Ni可以显著提高材料的热扩散率,这将有助 于提高 C/SiC材料的抗热震性能。

3.5 三点弯曲强度

实验测得 C/SIC 原料三点弯曲强度为 204.9 MPa,渗 Ni并沉积 SIC涂层后试样的三点弯曲强度为 190.1~226.7 MPa,可见,渗 Ni后材料的三点弯曲强 度变化不大。这是由于溶液浸渍还原法渗入的 Ni呈 颗粒聚集体态,Ni基体中仍有孔隙存在,因此,Ni并 不能与 SIC形成良好的界面结合,Ni的渗入对 C/SIC 复合材料的三点弯曲强度基本无影响。

4 结论

用液相浸渍还原法将 Ni渗入 C/SiC复合材料, Ni在复合材料内部呈颗粒聚集体态。沉积 SiC涂层 时 Ni与原 SiC基体反应生成 Nig Sig 渗 Ni后材料的 线胀系数变化趋势在 200~700 内与 C/SiC原料的 一致;但由于 Ni与 C/SiC材料之间的相互作用,曲线 于 800 时出现肩峰。因 SiC线胀系数高于 C/SiC渗 Ni材料,渗 Ni并沉积 SiC涂层后复合材料线胀系数 增大,但整体变化趋势仍与原料的一致。由于 Nig Si 导热能力优于 C/SiC材料,使 C/SiC原料、C/SiC渗 Ni并热处理后以及渗 Ni并沉积 SiC涂层后复合材料 的热扩散系数依次升高。

参考文献

1 张立同,成来飞,徐永东.新型碳化硅陶瓷基复合材料的研究进展.航空制造技术,2003;(1):24~32

2 段辉平,李树杰,张永刚等. SiC陶瓷与镍基高温合金的热压反应烧结连接.稀有金属,1999;23(5):326~329

3 童巧英,成来飞,张立同.三维 C/SiC复合材料在线液 相渗透连接.稀有金属材料与工程,2004;33(1):101~104

4 Yin Xiaowei, Cheng Laifei, Zhang Litong et al Thermal shock behavior of 3-dimensional C/SiC composite Carbon, 2002; 40 (6): 905 ~ 910

5 Mansour S A A. Spectroscopic and microscopic investigations of the thermal decomposition of nickle oxysalts Part 2 Nickle nitrate hexahydrate. Thermochimica Acta, 1993; 228: 173 ~189

6 Chou T C, Joshi A, Wadsworth J. Solid state reactions of SiC with Co, N i, and Pt J. Mater Res , 1991; 6(4): $796 \sim 809$

7 Park J S, Landry K, Perepezko J H. Kinetic control of silicon carbide/metal reactions Materials Science and Engineering, 1999; A259: 279 ~ 286

8 Du Y, Schuster J C Experimental investigations and thermodynamic description of Ni - Si and - C - Si - Ni systems Metallurgical and Materials Transactions A, 1999; 30: 2 409 ~ 2 418

9 Kin SN, Pepepezko J H, Dong Z et al Interface reaction between Ni and amorphous SiC Journal of Electronic Materials, 2004; 33 (10): 1 064 ~ 1 670

10 宁青菊,谈国强,史永胜.无机材料物理性能.北京: 化学工业出版社,2006:109~126

(编辑 李洪泉)

宇航材料工艺 2007年 第4期